## 04 Определение параметров плазмы с помощью зондирующего импульса магнитного поля

© А.Г. Русских<sup>1</sup>, В.И. Орешкин<sup>1,2</sup>, А.С. Жигалин<sup>1</sup>, Г.Ю. Юшков<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск <sup>2</sup> Томский политехнический университет, Томск E-mail: russ@ovpe2.hcei.tsc.ru

## Поступило в Редакцию 1 июля 2015 г.

Представлена экспериментальная методика определения электрической проводимости и температуры плазмы, основанная на сравнении сигналов, создаваемых импульсным магнитным полем в цепях двух зондов, один из которых расположен в объеме исследуемой плазмы, а другой — вне плазмы. Экспериментальная проверка предложенной методики измерений параметров плазмы осуществлена на примере определения проводимости и температуры плазменного потока, формируемого в катодных пятнах сильноточной импульсной вакуумной дуги с катодом из магния.

Методика определения параметров плазмы, основанная на взаимодействии исследуемой плазмы с импульсным магнитным полем, может быть рассмотрена на примере экспериментальной системы, схематически представленной на рис. 1. Суть методики состоит в сравнении сигналов, наводимых в цепях двух одновитковых зондов (петель) 1 и 2 [1,2] импульсным магнитным полем. Магнитное поле создается тестовым током  $I_{test}(t)$  в витке проводника 3, охватывающего диэлектрическую вакуумную камеру 4 внешним диаметром 2.5 сm, заполненную плазмой 5. Разница в показаниях сигналов зондов, реги-

1

1

стрирующих изменение производной напряженности магнитного поля, определяется тем, что зонд I расположен в исследуемой плазме, а зонд 2 находится снаружи и его сигнал используется как эталонный. Влияние плазмы на распространение в ней импульсного магнитного поля обусловлено возникновением в ней вихревых индуцированных токов. Поскольку диффузия магнитного поля в плазму происходит с конечной скоростью, то при достаточно коротких импульсах тока  $I_{test}(t)$ , создающего это поле, должно наблюдаться как уменьшение амплитуды напряжения  $V_1$  на зонде I по сравнению с эталонным сигналом  $V_2$  зонда 2, так и их временной сдвиг относительно друг друга. Степень уменьшения амплитуды и величину временно́го смещения сигнала  $V_1$  можно оценить из решения системы уравнений Максвелла.

Рассмотрим одномерный цилиндрический случай, в котором магнитное поле имеет только одну составляющую вдоль оси системы  $H_z$ , а наводимое им электрическое поле соответственно имеет только азимутальную составляющую  $E_{\varphi}$ . Тогда система уравнений Максвелла, записанных в квазистационарном приближении, т.е. без учета токов смещения, будет иметь вид [3]:

$$E_{\varphi} = \frac{1}{4\pi\sigma} \frac{\partial H_z}{\partial r},\tag{1}$$

$$\frac{1}{r}\frac{\partial(E_{\varphi}r)}{\partial r} = -\frac{1}{c}\frac{\partial H_z}{\partial t},\tag{2}$$

$$E_{\varphi} = j_{\varphi}/\sigma, \tag{3}$$

где  $j_{\varphi}$  — плотность вихревых токов, c — скорость света в вакууме,  $\sigma$  — проводимость плазмы. Граничные условия для системы уравнений (1)-(3) можно определить как: при  $r = 0 - E_{\varphi} = 0$ ; при  $r = R_{test}$ (радиус тестового токового витка) —  $H(r = R_{test}, t) = H_{test}(t) = f(t)$ . Функция f(t) определяется формой импульса тестового тока  $I_{test}(t)$ , значение которого должно быть достаточно малым, чтобы вихревые токи не влияли на параметры плазмы. При выполнении этого условия система уравнений (1)-(3) содержит два параметра:  $R_{test}$  и  $\sigma$ . Параметр  $R_{test}$  определяется конфигурацией системы, а параметр  $\sigma$  (проводимость плазмы, окружающей зонд I) является априори неизвестной, искомой величиной. Решая численно систему уравнений (1)-(3) при заданной функции f(t) можно рассчитать степень уменьшения амплитуды и величину временно́го сдвига сигнала  $V_1$  относительно эталонного сигнала  $V_2$ .



**Рис. 1.** Схема эксперимента: *1* — зонд в плазме разряда, *2* — эталонный зонд, *3* — виток проводника, создающего зондирующий импульс магнитного поля, *4* — диэлектрическая вакуумная камера, *5* — плазма вакуумного дугового разряда, *6* — магниевый катод, *7* — анод, *8* — коммутатор импульса тока разряда, *9* — конденсатор.

На рис. 2, *а* приведены результаты численных расчетов нормированного значения магнитного поля при r=0 ( $h_{calc} = H_{Z,calc}(r=0, t)/H_{test}^{max}$ , где  $H_{test}^{max}$  — максимальное значение напряженности магнитного поля), проведенных при различной проводимости плазмы. В расчетах использовалась функция f(t), пропорциональная измеренной временной зависимости тестового тока. Как следует из расчетных зависимостей, представленных на рис. 2, *a*, при росте проводимости плазмы, окружающей зонд, в эксперименте должно наблюдаться уменьшение амплитуды импульса магнитного поля и смещение во времени его максимального значения.



**Рис. 2.** a — расчетные зависимости нормированного значения магнитного поля  $h_{calc}$  для различной проводимости плазмы  $\sigma$ : I — без плазмы,  $2 - \sigma = 10^4 \Omega^{-1} \cdot m^{-1}$ ,  $3 - \sigma = 2 \cdot 10^4$ ,  $4 - \sigma = 4 \cdot 10^4$ ,  $5 - \sigma = 8 \cdot 10^4$ ,  $6 - \sigma = 1.6 \cdot 10^5 \Omega^{-1} \cdot m^{-1}$ . b — экспериментальные зависимости нормированного значения магнитного поля  $h_{exp}$ : I — эталонный сигнал зонда 2; 2 — сигнал зонда I без плазмы. Сигналы зонда I, полученные в различные моменты времени  $t_{delay}$  после инициирования разряда: 3 - 17.1, 4 - 11.1,  $5 - 2.3 \, \mu$ s.

В эксперименте поток плазмы 5 создавался в катодных пятнах, функционирующих на торце магниевого катода 6, при горении вакуумной дуги между ним и заземленным анодом 7 (рис. 1). Ток вакуумного дугового разряда достигал максимального значения в 70 kA на девятой микросекунде после замыкания коммутатора 8 при разряде конденсатора 9 емкостью  $20 \,\mu$ F, заряженного до напряжения 20 kV. Максимальная концентрация плазмы в области зонда 1 достигалась через промежуток времени  $1-2 \,\mu$ s после максимума тока разряда. Величина временно́го промежутка определяется скоростью ионов, эмитированных катодными пятнами [4–6], и расстоянием до зонда 1.

Отметим, что ранее подобная система из нескольких дуговых разрядов использовалась авторами для создания в диоде сильноточного импульсного генератора плазменных цилиндрических оболочек [7–10]. В свою очередь, эти плазменные оболочки ускорялись импульсами тока с амплитудой до 500 kA в геометрии Z-пинча, в результате чего формировался плазменный столб с температурой в сотни электронвольт.

Тестовый ток  $I_{test}(t)$  формировался при разряде конденсатора с запасенной энергией 50 mJ через одиночный токовый виток 3, а длительность его импульса составляла 65 пs. Поскольку энергия тестового сигнала была на несколько порядков меньше энергии в вакуумном дуговом разряде, то он не оказывал существенного влияния на параметры исследуемой плазмы. Полученные экспериментальные зависимости напряжений зондов  $V_1(t)$  и  $V_2(t)$  интегрировались по времени, и, таким образом, определялись напряженности магнитного поля в местах расположения зондов. Измерения проводились в различные моменты времени  $t_{delay}$  относительно начала протекания тока разряда. На рис. 2, *b* представлены экспериментальные зависимости нормированного значения магнитного поля  $h_{exp} = H_{Z,exp}(0, t)/H_{test}^{max}$ , вид которых согласуется с расчетными зависимостями, приведенными на рис. 2, *a*.

Для определения параметров плазмы были найдены две расчетные зависимости проводимости плазмы: первая — из уменьшения амплитуды сигнала  $V_1$  относительно сигнала  $V_2$ , а вторая — из временно́го сдвига этих сигналов относительно друг друга. Поскольку значения проводимости плазмы, полученные из этих расчетных зависимостей, незначительно различались, величина проводимости плазмы определялась в результате усреднения этих двух значений. Зависимость проводимости плазмы от времени  $t_{delay}$  после момента инициирования разряда представлена на рис. 3.



**Рис. 3.** Временная зависимость проводимости и температуры плазмы вакуумного дугового разряда с магниевым катодом.

Температура плазмы определялась в предположении спитцеровской проводимости [11] как

$$T = 1.4 \cdot 10^{-3} (\sigma \cdot \overline{Z} \cdot \ln \Lambda)^{2/3} \,\mathrm{eV},\tag{4}$$

где  $\overline{Z}$  — средний заряд ионов,  $\ln \Lambda = 10$  — кулоновский логарифм. В реализованном в эксперименте случае в потоке плазмы, эмитируемой катодными пятнами, присутствовали преимущественно двухзарядные ионы магния [4,5]. Это обусловлено наличием значительной разницы потенциалов ионизации одно- и двухзарядных ионов магния (15.0 и 80.1 eV соответственно [6]). Поэтому в широком диапазоне температур для "магниевой" плазмы  $\overline{Z} = 2$ . Зависимость температуры плазмы от времени  $t_{delay}$  после момента инициирования разряда также представлена на рис. 3.

Представленная в данной работе методика определения электрической проводимости и температуры плазмы, основанная на сравнении сигналов, наводимых импульсным магнитным полем в цепях двух зондов, один из которых помещен в плазму, а другой вынесен из нее, показала хорошее соответствие полученных результатов с независимыми измерениями параметров плазменной струи вакуумного дугового разряда [4]. Таким образом, данный подход может быть использован для достоверного определения таких параметров плазмы, как проводимость и температура.

## Список литературы

- [1] Wagoner T.C., Stygar W.A., Ives H.C. // Physical Review Special Topics Accelerators and Beams. 2008. V. 11. Article Number: 100401.
- [2] Лабецкий А.Ю., Кокшенев В.А., Курмаев Н.Е. и др. // Физика плазмы. 2008.
  Т. 34. № 3. С. 257–268.
- [3] Тамм И.Е. Основы теории электричества. М.: Наука, 1978. 614 с.
- [4] Юшков Г.Ю. Источники широкоапертурных пучков ионов газов и металлов на основе дугового и тлеющего разрядов при пониженном давлении: Дис.... доктора технических наук. Томск, 2001.
- [5] Бугаев А.С., Гушенец В.И., Николаев А.Г. и др. // ЖТФ. 2000. Т. 70. В. 9. С. 37–43.
- [6] Держиев В.И., Жидков А.Г., Яковленко С.И. Излучение ионов в неравновесной плотной плазме. М.: Энергоатомиздат, 1986. 160 с.
- [7] Русских А.Г., Шишлов А.В., Жигалин А.С. и др. // ЖТФ. 2010. Т. 80. В. 11. С. 73–81.
- [8] Rousskikh A.G., Zhigalin A.S., Oreshkin V.I. et al. // Phys. Plasmas. 2011. V. 18. Article Number: 092707.
- [9] Rousskikh A.G., Zhigalin A.S., Oreshkin V.I. et al. // Phys. Plasmas. 2014. V. 21. Iss. 5. Article Number: 052701.
- [10] Жигалин А.С., Русских А.Г., Бакшт Р.Б. и др. // Письма в ЖТФ. 2015. Т. 41.
  В. 11. С. 86–92.
- [11] Брагинский С.И. // ВТП. В. 1. С. 183–272.